

金沢大学教育 広瀬幸雄, 京大工 田中啓介
金沢工大 矢島善次郎, 大阪府大工 岡林邦夫

1. 緒言

高張力鋼(SNCM8)の3.5%NaCl中の応力腐食き裂は通常先端が微視分岐しており、前報においてこの微視分岐き裂先端近傍の局部力学場を鉛化き裂でモデル化することより、破面の様相が応力拡大係数より伝ば速度とより密接に関係する実験結果を説明した。本研究ではこのモデルを実験的に検証し微視分岐の程度との対応を検討した。

2. 鉛化き裂モデル

半径 r_0 を有する切欠き材の破壊が $K_0/\sqrt{r_0}$ で決定されるとすると、き裂発生に対する破壊韌性 K_{0I} と、疲労き裂材の破壊韌性 K_I が次の関係で結ばれる。

$$K_I = (\sigma_I / \sigma_0)^{1/2} K_{0I} \quad (1)$$

ここで σ_I は疲労き裂に対する切欠き半径である。ここで応力腐食き裂成長試験を中断し、ベーキングした後の空気中の破壊韌性試験値 K_{isc} が求まると、その値より上式に代入しこの切欠き半径 σ_{eq} を次式で求めること。

$$\sigma_{eq} = \sigma_0 (K_{isc} / K_I)^2 \quad (2)$$

よって微視分岐き裂の等価応力拡大係数 K_{eq} は、負荷している応力拡大係数 K_{app} とし、次式で表わされる。

$$K_{eq} = (\sigma_I / \sigma_{eq})^{1/2} K_{app} = (K_I / K_{isc}) K_{app} \quad (3)$$

そして伝ば速度はこの K_{eq} の関数として表わされることが予想される。

3. 実験方法

供試材は市販のSNCM8鋼(wt% 0.39C, 0.28Si, 0.74Mn, 1.38Ni, 0.78Cr, 0.23Mo)であり、試験片形状はコンパクト引張型試験片である。応力腐食き裂進展実験も前報と同様に行つた。またK一定試験中実験を中断し、150°C 50hr 真空中でベーキングした後破壊韌性試験をした。一方切欠き半径 r_0 を変えた試験片を準備し破壊韌性試験を行い韌性値と r_0 の関係を求めた。この両者の破壊韌性値としては電位差法を使用しき裂発生に対する K_I を採用した。また応力腐食き裂の微視分岐の判定は試験を中断し表面をバフ研磨後走査型電子顕微鏡により観察した。

4. 実験結果および考察

4.1 応力腐食き裂の分岐

き裂の分岐幅 w_b を測定し、焼もどし温度200°C, 板厚 $B=2\text{ mm}$ および400°C・ $B=15\text{ mm}$ における K_{app} に対する伝ば速度 da/dt および分岐幅 w_b の関係をFigs. 1, 2に示す。分

岐幅 w_b は伝ば曲線の第Ⅰ領域より増大し、第Ⅱ領域で極大となりその後再び減少する。また Fig. 2 において板厚中央部の方が表面における値より大きい。

4.2 切欠き材の破壊韌性

き裂発生から求めた破壊韌性 K_{Ic} と δ との関係を Fig. 3 に示す。 K_{Ic} は $\sqrt{\delta}$ に比例して増大する。この傾向は白砂らによつても SNCM8 に関して種々の板厚で認められている。図中縦軸上の点が ASTM E-399 に従う疲労き裂材の破壊韌性 K_I である。ここで Fig. 3 の場合に關して(1)式より δ_I を求める $\approx 200^\circ\text{C}, 400^\circ\text{C}$ 焼もどしに対して $40, 44 \mu\text{m}$ である。

4.3 等価切欠き半径の評価

$B=2\text{mm}$ の試験片に關し KAPP - 定で進展させた応力腐食き裂をペーリング後破壊韌性値 K_{Isc} を求め、(2)式に代入し δ_{eq} を求めた結果を Table 1 にまとめる。また 4.1 で求めた分岐幅 w_b もまとめて示す。ここで

$$\delta_{eq} = 2 w_b \quad (4)$$

の関係が大体成立している。

(4)式の関係が一般的に成立すると(4)式を(3)式に代入して

$$K_{eq} = (\delta_{eq}/2w_b)^{1/2} K_{app} \quad (5)$$

が求まる。従つて Figs. 1, 2 の様な分岐幅に関するデーターのみから K_{eq} が求まる。 da/dt はこの K_{eq} の関数となる。

4.4 微視分岐を支配する因子

支配因子として上述 K , B などの機械的因子の他焼もどし温度など材料および環境により影響される。Fig. 4 は伝ば曲線第Ⅱ期中点における w_b の焼もどし温度に対する変化を示す。また Fig. 5 は対応する $(da/dt)_{II}$, 水素溶解量 C_0 および拡散定数 D を示す。両図を比較して C_0 大のとき D 小で w_b も小さく da/dt は大きくなる傾向を示す。(以下略)

Table 1. $K_{app}, w_b, K_{Isc}, k_i, w, \delta_{eq}, \delta_I$

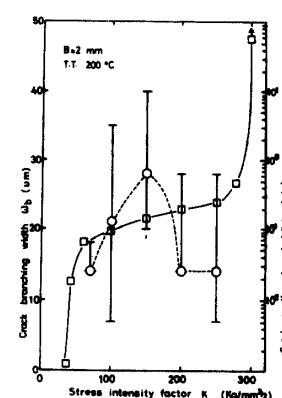


Fig. 1 K vs $da/dt, w_b$

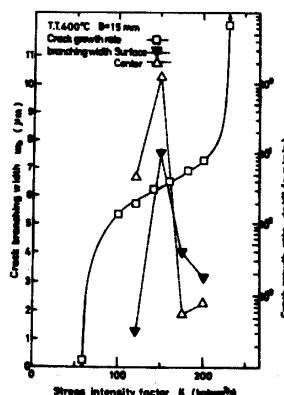


Fig. 2 K vs $da/dt, w_b$

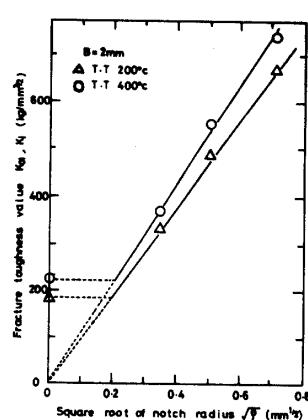


Fig. 3 K_{Ic} vs \sqrt{r}

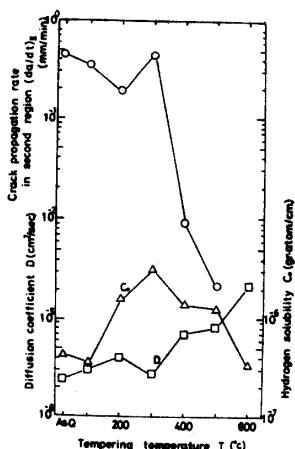


Fig. 4 $T.T.$ vs $da/dt, D, C_0$

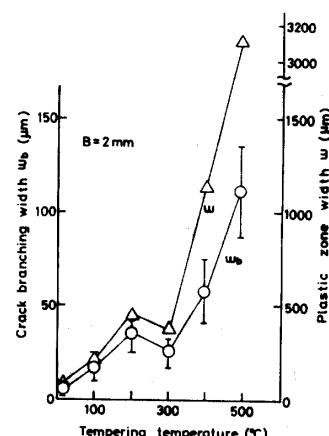


Fig. 5 $T.T.$ vs w_b, w